

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน โดยในปี พ.ศ. 2548 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งที่สำเร็จรูปและที่เป็นชิ้นส่วนได้สูงถึง 415,711 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของการส่งออกสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 10 ของการส่งออกโดยรวมของทั้งประเทศนอกจากนั้นในปีเดียวกันประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับ 1 ของโลกเป็นปีแรกโดยมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 42 ของตลาดโลกการที่การผลิตและส่งออกจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกถึง 4 บริษัท คือ Seagate, Hitachi Global Storage Technology (HGST), Western Digital (WD), และ Fujitsu/Toshiba (ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1.1) ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลประกาศให้มีการส่งเสริมการลงทุนเป็นการเฉพาะสำหรับกิจการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 บริษัทเหล่านี้ต่างขยายกำลังการผลิตจนทำให้ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่สำคัญของโลกอีกประเทศหนึ่งนอกเหนือจากสิงคโปร์, มาเลเซีย, และจีน

ตารางที่ 1.1 การเข้ามาของผู้ประกอบการฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ในประเทศไทย

บริษัทประกอบฮาร์ดดิสก์	ปีที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
Seagate	1983
Fujitsu/Toshiba	1994
Western Digital	2002
Hitachi Global Storage Technology	2003 (รวมกับ IBM)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการการลงทุน (BOI)

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ไม่เพียงก่อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างรายได้แก่ประเทศในฐานะของสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศถึง 100,000 อัตราและสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ตารางที่ 1.2 การผลิต และการส่งออกของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ของไทย

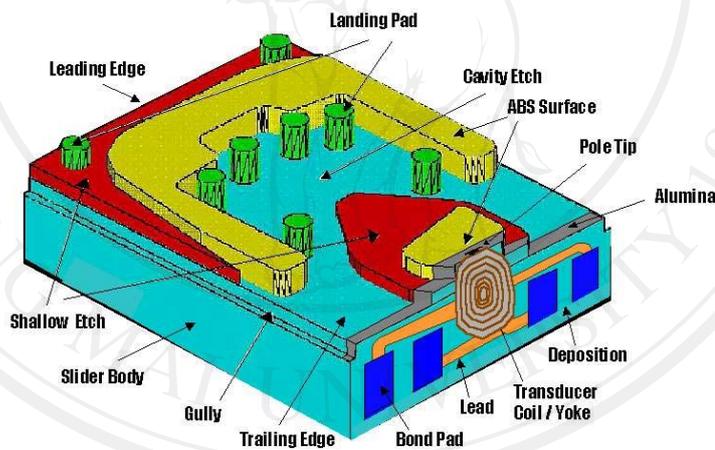
	2546	2547	2548	2549
ปริมาณการผลิต(ล้านชิ้น)	84.1	74.1	119.8	169.1
อัตรากาขยายการผลิต(ร้อยละ)	-	37.0	61.7	41.7
มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไครฟ์และส่วนประกอบ(ล้านบาท)	303,230	329,291	415,7112	497,4562
- ฮาร์ดดิสก์ไครฟ์สำเร็จรูป	121,000	163,000	25,000	87,000
- ชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์	182,230	166,291	190,711	210,000
สัดส่วนการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ ในการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย(ร้อยละ)	26	25	29	32
ส่วนแบ่งในตลาดโลกที่ประเทศไทยทำได้(ร้อยละ)	19.50	19.90	42.00	48.00

ที่มา: The International Disk Drive Equipment and Materials Association ประเทศไทย (IDEMA Thailand) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หมายเลข: ปี 2549 เป็นข้อมูลประมาณการ

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิต และส่งออกฮาร์ดดิสก์ไครฟ์สร้างมูลค่าจำนวนมากมหาศาล ทำให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูง มีการลงทุนทั้งในด้านการขยายฐานกำลังผลิต การปรับปรุงการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตตลอดเวลา โดยเฉพาะการลงทุนด้านการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพในด้านความจุ และความเร็วรอบในการอ่านฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ที่มากขึ้นขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและออกแบบผลิต และจำหน่ายฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลระบบดิจิทัล นอกจากนั้นยังเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปัจจุบัน มีพนักงานมากกว่า

24,000 คน และยังมีการขายงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นฐานการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ (Slider Fabrication) ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด และทางบริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการผลิตนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เริ่มจากการนำเวเฟอร์ 1 แผ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว (ผลิตหัวอ่านได้ 60,787 ชิ้น) มาตัดเป็นแท่ง(bar) นำไปประกอบเข้ากับ Toolingbar ผ่านกรรมวิธีต่างๆ เช่น การฉายภาพ การกัด เป็นต้น เพื่อทำเป็นหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 1.1 หลังจากนั้นนำหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ มาประกอบเข้ากับ Head Gimbal Assembly (HGA) และนำ HGA หลายๆตัว มาประกอบเป็น Head Stack Assembly (HAS) แล้วส่งไปประกอบหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ที่ฐานการผลิตนิคมอุตสาหกรรมนวนครและประเทศมาเลเซีย โดยขั้นตอนการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ แสดงดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.1 ภาพผลิตภัณฑ์หัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์

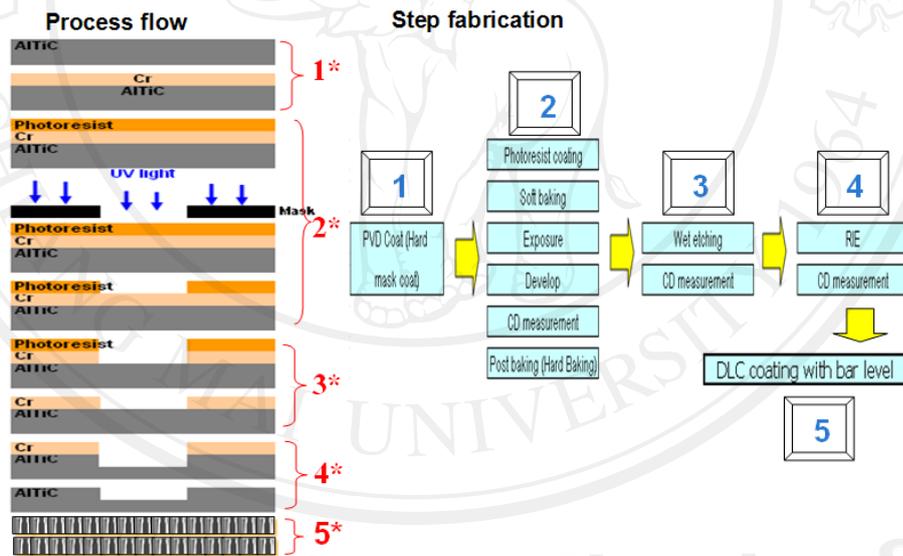


ในส่วนของกระบวนการประกอบหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ มีกระบวนการหนึ่ง ซึ่งในอดีตบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล มีการสั่งทำมาจากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันได้ทำการผลิตเอง เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุน และกำลังการผลิต ซึ่งกระบวนการนี้ คือ กระบวนการผลิต Specialty head ซึ่งจะทำหน้าที่ในการปรับความเรียบของแผ่นบันทึกข้อมูล (Platters) หากแผ่นบันทึกข้อมูลไม่เรียบและมีความขรุขระจะส่งผลต่อการบินของหัวอ่าน-เขียน ในขณะที่หัวอ่านเขียนกำลังทำการอ่านเขียนสัญญาณลงบนแผ่นบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ตามมาด้วยปัญหาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือ และลูกค้าขาดความไว้วางใจในที่สุด

ปัจจุบันกระบวนการผลิต Specialty head มีอยู่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ Burnish head ABS ซึ่งจะทำหน้าที่ในการปรับความเรียบของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบหยาบและ Glide head ABS ทำหน้าที่ในการปรับความเรียบของแผ่นบันทึกข้อมูลแบบละเอียด โดยกระบวนการผลิตจะใช้แผ่น AlTiC หรือ  $Al_2O_3$ -TiC เคลือบด้วยโครเมียม (Cr) และสารไวแสง AZ P4620 (Photoresist AZ P4620) แล้วทำการฉายลวดลายด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) จากนั้นทำการล้างสารไวแสง และกัดโครเมียมออกบางส่วน สุดท้ายทำการกัดด้วยเครื่องรีแอคทีฟ ไอออน (Reactive Ion Etching : RIE) ในบริเวณที่ไม่มีโครเมียมเคลือบอยู่ แล้วทำการวัดค่ามิติวิกฤต (Critical Dimension : CD) ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รูปที่ 1.3 แสดงกระบวนการสร้างลวดลายบนแผ่น AlTiC โดยพบว่าต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากต้องใช้สารละลายในการกัดโครเมียมที่มีราคาสูง อีกทั้งทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หากทำการกำจัดที่ไม่ได้คุณภาพ และปัญหาในเรื่องมุม ความลึก และความเรียบของชิ้นงาน ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานส่งผลให้เมื่อนำไปขัดแผ่นบันทึกข้อมูลทำให้ได้ความเรียบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการอ่าน-เขียนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ต่อไป

จากปัญหาที่กล่าวมามีผลโดยตรงต่อต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยการศึกษากระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยใช้สารไวแสงชนิดลบ SU-8 เป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างลวดลายขึ้น ซึ่งจากการศึกษาการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนที่ระบบลำเลียงแสง BL6a: Deep X-ray Lithography (DXL) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พบว่าเป็นระบบลำเลียงแสงในย่านรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ ซึ่งจะยอมให้แสงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 1.24 nm (ย่านรังสีเอกซ์ขึ้นไป) เดินทางผ่านไปยังสถานีออบรังสีได้ แสงซินโครตรอนเป็นแสงที่มีความเข้มแสงที่สูง มีความยาวคลื่นที่สั้น มีการเบี่ยงเบนของคลื่นที่น้อยมาก มีความละเอียดสูงในการสร้างช่องว่างและแทรกผ่านผิววัตถุได้ดี ส่งผลให้โครงสร้างที่ได้มีความผิดเพี้ยนจากที่ออกแบบน้อยมาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของแสงซินโครตรอนในการสร้างลวดลายระดับไมโครเมตร

สำหรับการสร้างลายของ Burnish head ABS บนแผ่น AITiC นั้น การเลือกใช้วัสดุที่ทำปฏิกิริยากับรังสีเอกซ์ได้ดี เช่น สารไวแสงชนิดลบ SU-8 จะช่วยให้ค่ามิติวิกฤตของโครงสร้างมีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก รวมทั้งวัสดุชนิดนี้ก็นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพราะความแข็งแรงของโครงสร้างที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแรงกระทำได้มาก รวมทั้งการเคลือบบนแผ่น AITiC ที่ใช้กระบวนการเคลือบพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้มีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นหน้ากากแข็งสำหรับการสร้างลาย Burnish head ABS บนแผ่น AITiC แทนโครเมียม นอกจากนี้ การกำจัดวัสดุ SU-8 ออกจากแผ่น AITiC นั้นมีต้นทุนที่ถูกและสารเคมีที่ใช้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่าสารละลายในการกำจัดโครเมียม การคำนวณระดับความหนาของวัสดุ SU-8 ที่เหมาะสมกับระยะความลึกในการกัด AITiC ยังช่วยลดเวลาในการกำจัดวัสดุ SU-8 ที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อดีทั้งหมดแล้ว จะพบว่าสารไวแสง SU-8 มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับป้องกันการกัดลาย AITiC ในระบบ RIE แทนการใช้โครเมียมในปัจจุบัน



รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการผลิต Specialty head

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการสร้างลวดลายโครงสร้างจุลภาคโดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเพื่อเป็นแนวทางการรองรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต
- 1.2.2 เพื่อทำการสร้างลาย Burnish head ABS บนแผ่น AITiC โดยการใช้สารไวแสง SU-8 ที่ขึ้นลายด้วยกระบวนการลิโทกราฟีด้วยรังสีเอกซ์ เป็นหน้ากากแข็งในการกัดด้วย RIE

- 1.2.3 เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการใช้แสงซินโครตรอนในการสร้างลาย Burnish head ABS

### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- 1.3.1 ใช้แสงซินโครตรอน ในย่านรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ ณ ระบบลำเลียงแสง BL6a: Deep X-ray Lithography (DXL) ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในการขึ้นลายโครงสร้างจุลภาค
- 1.3.2 สร้างลาย Burnish head ABS สำหรับหน้ากาคูดซ์บรังสีเอกซ์ เพื่อกำหนดความละเอียดของชิ้นงาน
- 1.3.3 การกัดจะใช้กระบวนการกัดด้วยการกัดแบบรีแอคทีฟไอออน (Reactive Ion Etching : RIE)
- 1.3.4 ตัวชี้วัดที่ทำการศึกษาในกระบวนการสร้างลาย (Photolithography)
- 1.3.4.1 ความคมชัดของลวดลายที่เกิดขึ้นตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopoe: SEM)
- 1.3.4.2 มิติวิกฤต (Critical Dimension :CD)
- 1.3.5 ปัจจัยที่ทำการศึกษาในกระบวนการสร้างลาย (Photolithography)
- 1.3.5.1 พลังงานในการอบรังสีเอกซ์ ( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )
- 1.3.5.2 ความหนาของสารไวแสง SU-8 ( $\mu\text{m}$ )
- 1.3.5.3 เวลาในการกัดด้วย RIE (hours)

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้แนวทางในการศึกษาวิจัยขั้นตอนการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ในอนาคต
- 1.4.2 ได้ลาย Burnish head ABS บนแผ่น AITiC โดยการใช้สารไวแสง SU-8 ที่ขึ้นลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นหน้ากาคูแข็งในการกัดด้วย RIE
- 1.4.3 ได้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการใช้กระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนในการสร้างลาย Burnish head ABS